(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-140695

(43)公開日 平成6年(1994)5月20日

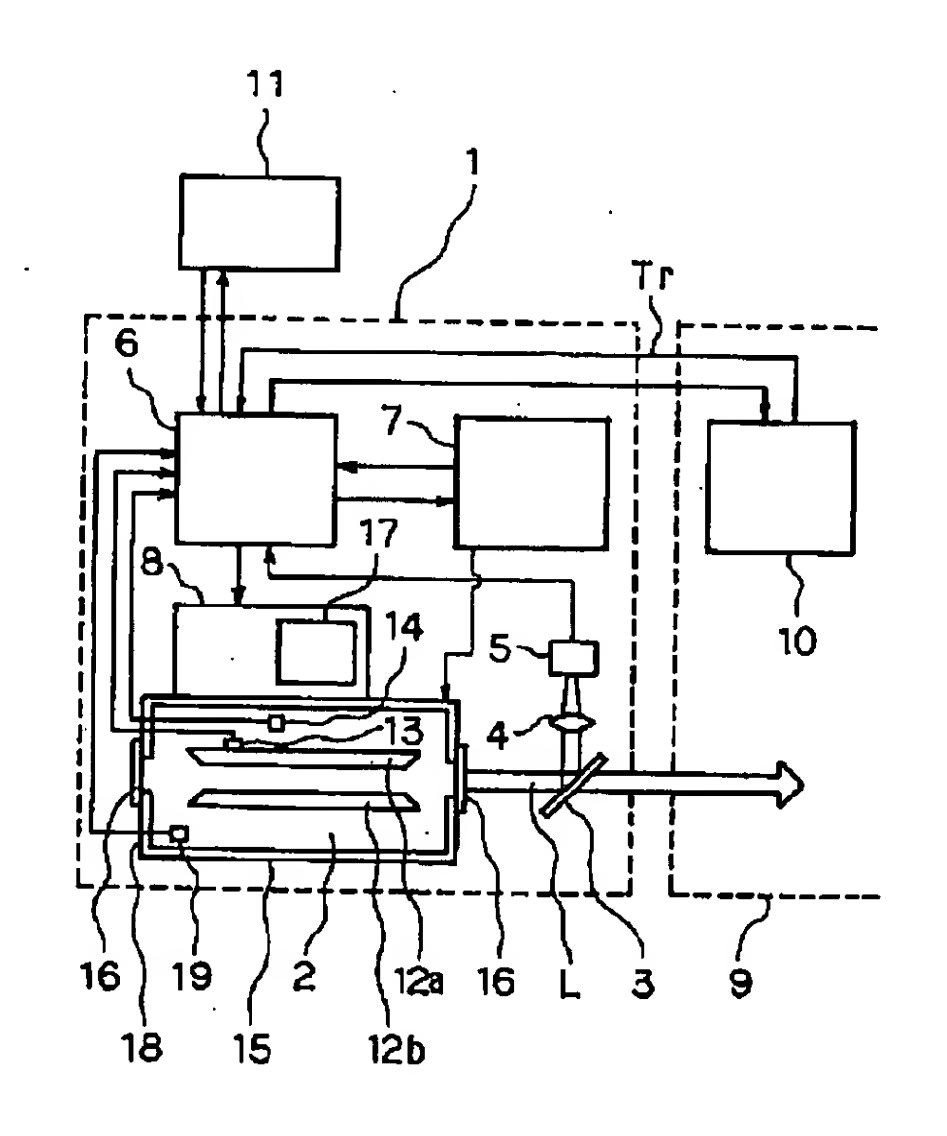
(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所			
H 0 1 S 3/036 3/032							
•		7454-4M	H01S	3/03			J
		7454-4M			F		
			5	審査請求	未請求	請求項0	D数17(全 11 頁)
(21)出願番号	特顧平5-19220		(71)出願人	000001236 株式会社小松製作所			
(22) 出願日	平成5年(1993)1月		東京都港区赤坂二丁目3番6号				
			(72)発明者	天田 秀	亨穂		
(31)優先権主張番号)優先権主張番号 特願平4-245239			神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製			
(32)優先日	平4 (1992) 9 月14日	月14日 作所研		作所研究	究所内		
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	若林 玛	1			
				神奈川県	平塚市入	5田1200	株式会社小松製
				作所研究	流内		
			(72)発明者	伊藤 化	山聡		
				神奈川県	是平塚市刀	5田1200	株式会社小松製
				作所研究	的内		
			(74)代理人	弁理士	橋爪 上	該	

(54) 【発明の名称】 エキシマレーザ装置の出力制御装置

(57)【要約】

【目的】 バーストモードで運転されるエキシマレーザ 装置において、スパイキング現象の影響を除去して、露 光量制御の精度を向上する。

【構成】 スパイキング現象に影響する種々のパラメータの検出用に、放電電極12aに電極温度センサ13を、レーザチャンバ15内にガス温度センサ14とHF 濃度をモニタするHFセンサを配設する。前配各センサと、出力モニタ5と、レーザガスを制御するガス制御部7と、ステッパ制御部10とからの信号を受け、レーザ電源8に電圧データを加える出力制御部6を設ける。出力制御部6は前記各種パラメータの信号を受け、各バルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、パラメータの値に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを演算し、レーザ電源に電圧データを送って放電電圧を変化させ、スパイキング現象の影響を除去して所望のパルスエネルギーを得、露光量制御の精度を向上する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように、レーザチャンバ内のレーザガスを励起させる放電電圧を制御するとともに、前記レーザガスの劣化に応じて前記所定の大きさのエネルギーを得るためのパワーロック電圧を変化させるパワーロック制御を行うエキシマレーザ装置の制御装置において、前記パワーロック電圧を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギ 10一が同一の大きさとなるように、前記検出されたパワーロック電圧に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項2】 レーザチャンパ内のレーザガスの交換を行うことにより前記レーザチャンパ内に新しいレーザガスを封入するとともに、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように前記レーザガスを励起させる放電電圧 20 を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザチャンパ内に新しいレーザガスを封入してからの経過時間を計時し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記計時された経過時間に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項3】 レーザチャンバ内のレーザガスの交換を行うことにより前記レーザチャンバ内に新しいレーザガスを封入するとともに、レーザ光を所定回数連続してパ 30 ルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように前記レーザガスを励起させる放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザチャンバ内に新しいレーザガスを封入してからの累積発振パルス数を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記検出された累積発振パルス数に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。 40

【請求項4】 レーザチャンバ内のレーザガスの交換を行うことにより前記レーザチャンバ内に新しいレーザガスを封入するとともに、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように前記レーザガスを励起させる放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザチャンパ内に封入されたレーザガスの種類とレーザガスの種類ごとの分圧とを検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるよう 50

に、前記検出されたレーザガスの種類とレーザガスの種類ごとの分圧とに基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項5】 レーザガスの種類とレーザガスの種類ごとの分圧の検出は、レーザガスの交換時に行い、次回の交換までの各連続パルスに対応する放電電圧の制御は前回の交換時における検出結果に基づき行うものである請求項4のエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項6】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように、レーザチャンパ内のレーザガスを励起させる放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザガスの温度を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記検出されたレーザガスの温度に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項7】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前配パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように、レーザチャンバ内の放電電極間の放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記放電電極の温度を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記検出された放電電極の温度に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項8】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、連続パルス発振の繰り返し周波数を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーか同一の大きさとなるように、前記検出された繰り返し周波数に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項9】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振 させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り 返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御 装置において、前記運転を開始してからの経過時間を計時し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記計時された経過時間に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項10】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさに

なるように放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記パルス発振間隔を計時し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記計時された発振間隔に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項11】 放電電極を有したレーザヘッドの交換が行われるとともに、レーザ光を所定回数連続してバルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大き 10 さとなるように、前記放電電極間の放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザヘッドが交換されてからの累積発振パルス数を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記検出された累積発振パルス数に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項12】 レーザチャンバ内の放電電極間の放電 電圧を放電前に充電する充電回路を交換自在に配設する とともに、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させ 20 た後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し 行い、前記パルスのエネルギーが同一の大きさとなるよ うに、前記レーザチャンバ内の放電電極間の放電電圧を 制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記 充電回路が交換されてからの累積発振パルス数を検出 し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーか同一の 大きさとなるように、前記検出された累積発振パルス数 に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化 させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項13】 レーザ光が射出されるレーザウインド 30 をレーザチャンパに交換自在に設けるとともに、レーザ 光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように、前記レーザ チャンパ内のレーザガスを励起させる放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザ ウインドが交換されてからの累積発振パルス数を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の 大きさとなるように、前記検出された累積発振パルス数に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化 40 させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項14】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記パルス発振の休止時間を計時し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記計時された休止時間に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項15】 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように、レーザチャンパ内のレーザガスを励起させる放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザチャンパ内のレーザガスに含まれる不純物濃度を検出する手段を有し、前記検出されたレーザガスに含まれる不純物の濃度に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項16】 前記請求項15記載のレーザガスに含まれる不純物がフッ化水素(HF)である、請求項15記載のエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【請求項17】 前記請求項1から17までの制御方法の任意の組み合わせによって、各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしたエキシマレーザ装置の出力制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、主として逐次移動型縮 小投影露光装置(以下、「ステッパ」と呼ぶ)の光源と して用いられ、放電励起されることによってレーザを発 振するエキシマレーザ装置の出力制御装置に関する。

[0002]

【従来の技術】本明細書においてはパルス放電励起型KrFエキシマレーザを例に説明する。なお、本明細書にある「連続的にパルス発振を行い」あるいは「連続パルス」「連続パルス発振」とは、パルス放電を繰り返し行うことで断続的なパルスレーザ光を繰り返し得ることであり、従って、一般に言われる「連続発振レーザ」あるいは「CW発振」とは異なる発振形態である。

【0003】ステッパにおいては、回路パターンの解像度を一定のレベル以上に維持するために厳密な露光量制御が必要とされる。一方、このステッパの光源として使用されるエキシマレーザは、いわゆるパルス放電励起ガスレーザのために1パルス毎にパルスエネルギーにバラッキがあり、露光量制御の精度向上のためにはこのバラッキを小さくする必要がある。しかも、断続光であるために、連続光である水銀ランプを光源とした場合の従来のシャッタ制御とは異なった露光量制御が必要である。

【0004】そこで、従来の方法は、たとえば、文献(宮地ほか、「エキシマレーザリソグラフィ」、国際レーザ/アプリケーション1991、セミナーL-5、P36-51)に見られるように、複数のパルスを連続パルス発振して露光を行う、いわゆる複数パルス露光によって露光量制御の精度向上を図ろうとするものである。

【0005】この方法は、エキシマレーザの発振パルスのエネルギーのバラツキがほぼ正規分布で近似できるため、n回パルス発振させて露光した後の積算エネルギー 50 のパラツキが1パルスのエネルギーのパラツキに対し 5

て、1/√nになることを利用したものである。すなわち、1パルスのエネルギーのバラツキをΔP/P、必要な露光量制御精度をAとすると、それに必要な露光パルス数Nは以下の関係で与えられる。

$N \ge \{ (\Delta P/P) / A \} 2$

たとえば、1パルスのエネルギーのバラツキ Δ P/Pが15%(3 σ)、必要な酵光量制御精度Aが1.5% (3 σ)であれば、 $N \ge 100$ となり、100回以上の連続パルス発振で所望の精度を達成することができる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、ステッパは、露光とステージ移動とを交互に繰り返す。このため、光源となるエキシマレーザの運転状態としては、必然的にいわゆるバーストモードとなる。パーストモードとは、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行うことをいう。つまり、短期間の連続パルス発振期間と短期間の発振休止期間とを交互に繰り返すものである。

【0007】上述したように、エキシマレーザはパルス 放電励起ガスレーザであるため、常に一定の大きさのパ 20 ルスエネルギーで発振を続けることが困難である。その 原因としては、放電されることによって放電空間内にレ ーザガスの密度擾乱が発生し、次回の放電を不均一に、 また、不安定にしたりする。この不均一放電等のため放 電電極の表面において局所的な温度上昇が発生し、さら に次回の放電を劣化させ、放電を不均一で不安定なもの にするためである。特に、上記連続パルス発振期間の初 期においてその傾向が顕著であり、発振休止期間経過後 の最初のパルスでは、安定な放電が得られ比較的高いパ ルスエネルギーが得られるが、その後は放電が劣化し徐 30 々にパルスエネルギーが低下するという、いわゆるスパ イキング現象が現れる。図3はこの現象を示すもので、 縦軸はパルスエネルギーを示し、横軸は時間を示す。図 に示すように連続パルス発振期間の初期B部はパルスエ ネルギーは高く、時間とともに徐々に低下する。

【0008】このようにパーストモード運転のエキシマレーザ装置では、前述した1パルスごとのエネルギのパラツキが露光量制御の精度を制限するとともに、スパイキング現象がさらにパラツキを著しく大きくし露光量制御の精度を制限するという問題がある。

【0009】しかも近年、ウエハに塗布する感光剤の感度が向上しており、少ない連続パルス数での露光が可能となっており、パルス数減少の傾向にある。しかし、パルス数が少なくなると、それに応じてパルスエネルギーのパラツキが大きくなってしまい、前述した複数パルス露光制御のみによっては露光量制御の精度の維持が困難になる。そこで、パルスエネルギーのバラツキの改善、特にバーストモードにおけるスパイキング現象の影響を除去することが望まれている。

【0010】本発明はこうした実情に鑑みてなされたも 50

のであり、パーストモードで運転されるエキシマレーザ 装置において、スパイキング現象の影響を除去して露光 量制御の精度を、たとえ少ない連続パルス発振であって も向上させることができるエキシマレーザ装置の出力制 御装置を提供することを目的としている。

6

[0011]

【課題を解決するための手段】上記の目的達成のため、 本発明に係るエキシマレーザ装置の出力制御装置の第1 の発明においては、レーザ光を所定回数連続してパルス 発振させた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を 繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさ となるように、レーザチャンバ内のレーザガスを励起さ せる放電電圧を制御するとともに、前記レーザガスの劣 化に応じて前記所定の大きさのエネルギーを得るための パワーロック電圧を変化させるパワーロック制御を行う エキシマレーザ装置の制御装置において、前記パワーロ ック電圧を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネ ルギーが同一の大きさとなるように、前記検出されたパ ワーロック電圧に基づいて各パルスに対応する放電電圧 を変化させるようにしており、第2の発明においては、 レーザチャンパ内のレーザガスの交換を行うことにより 前記レーザチャンパ内に新しいレーザガスを封入すると ともに、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた 後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行 い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるよう に前記レーザガスを励起させる放電電圧を制御するエキ シマレーザ装置の制御装置において、前記レーザチャン バ内に新しいレーザガスを封入してからの経過時間を計 時し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一 の大きさとなるように、前記計時された経過時間に基づ いて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させる ようにしており、第3の発明においては、レーザチャン パ内のレーザガスの交換を行うことにより前記レーザチ ャンパ内に新しいレーザガスを封入するとともに、レー ザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間 パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パル スのエネルギーが所定の大きさとなるように前記レーザ ガスを励起させる放電電圧を制御するエキシマレーザ装 置の制御装置において、前記レーザチャンパ内に新しい 40 レーザガスを封入してからの累積発振パルス数を検出 し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の 大きさとなるように、前記検出された累積発振パルス数 に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化 させるようにしており、第4の発明においては、レーザ チャンパ内のレーザガスの交換を行うことにより前記レ ーザチャンパ内に新しいレーザガスを封入するととも に、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、 所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、 前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように前 記レーザガスを励起させる放電電圧を制御するエキシマ

8

7

レーザ装置の制御装置において、前記レーザチャンパ内 に封入されたレーザガスの種類とレーザガスの種類ごと の分圧とを検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネ ルギーが同一の大きさとなるように、前記検出されたレ ーザガスの種類とレーザガスの種類ごとの分圧に基づい て各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるよ うにしており、第5の発明においては、レーザガスの種 類とレーザガスの種類ごとの分圧の検出は、レーザガス の交換時に行い、次回の交換までの各連続パルスに対応 する放電電圧の制御は前回の交換時における検出結果に 基づいて行うことにしており、第6の発明においては、 レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた後、所定 時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記 パルスのエネルギーが所定の大きさとなるように、レー ザチャンパ内のレーザガスを励起させる放電電圧を制御 するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レー ザガスの温度を検出し、つぎの連続パルスの各パルスの エネルギーが同一の大きさとなるように、前記検出され たレーザガスの温度に基づいて各パルスに対応する放電 電圧の大きさを変化させるようにしており、第7の発明 20 においては、レーザ光を所定回数連続してパルス発振さ せた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返 し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなる ように、レーザチャンバ内の放電電極間の放電電圧を制 御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記放 電電極の温度を検出し、つぎのパルスの各パルスのエネ ルギーが同一の大きさとなるように、前記検出された放 電電極の温度に基づいて各パルスに対応する放電電圧の 大きさを変化させるようにしており、第8の発明におい ては、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた 後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行 い、前記パルスのエネルギーか所定の大きさとなるよう に放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置に おいて、連続パルス発振の繰り返し周波数を検出し、つ ぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさ となるように、前記検出された繰り返し周波数に基づい て各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるよ うにしており、第9の発明においては、レーザ光を所定 回数連続してパルス発振させた後、所定時間パルス発振 を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネル 40 ギーが所定の大きさとなるように放電電圧を制御するエ キシマレーザ装置の制御装置において、前記運転を開始 してからの経過時間を計時し、つぎの連続パルスの各パ ルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、前記計 時された経過時間に基づいて各パルスに対応する放電電 圧の大きさを変化させるようにしており、第10の発明 においては、レーザ光を所定回数連続してパルス発振さ せた後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返 し行い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなる ように放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装

置において、前記パルス発振間隔を計時し、つぎの連続 パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるよ うに、前記計時された発振間隔に基づいて各パルスに対 応する放電電圧の大きさを変化させるようにしており、 第11の発明においては、放電電極を有したレーザヘッ ドの交換が行われるとともに、レーザ光を所定回数連続 してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止さ せる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所 定の大きさとなるように、前記放電電極間の放電電圧を 制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記 レーザヘッドが交換されてからの累積発振パルス数を検 出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一 の大きさとなるように、前記検出された累積発振パルス 数に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変 化させるようにしており、第12の発明においては、レ ーザチャンパ内の放電電極間の放電電圧を放電前に充電 する充電回路を交換自在に配設するとともに、レーザ光 を所定回数連続してパルス発振させた後、所定時間パル ス発振を休止させる運転を繰り返し行い、前記パルスの エネルギーが所定の大きさとなるように、前記レーザチ ャンパ内の放電電極間の放電電圧を制御するエキシマレ ーザ装置の制御装置において、前記充電回路が交換され てからの累積発振パルス数を検出し、つぎの連続パルス の各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、 前記検出された累積発振パルス数に基づいて各パルスに 対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしてお り、第13の発明においては、レーザ光が射出されるレ ーザウインドをレーザチャンパに交換自在に設けるとと もに、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた 後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行 い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるよう に、前記レーザチャンパ内のレーザガスを励起させる放 電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置におい て、前記レーザウインドが交換されてからの累積発振パ ルス数を検出し、つぎの連続パルスの各パルスのエネル **ギーが同一の大きさとなるように、前記検出された累積** 発振パルス数に基づいて各パルスに対応する放電電圧の 大きさを変化させるようにしており、第14の発明にお いては、レーザ光を所定回数連続してパルス発振させた 後、所定時間パルス発振を休止させる運転を繰り返し行 い、前記パルスのエネルギーが所定の大きさとなるよう に放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置に おいて、前配パルス発振の休止時間を計時し、つぎの連 続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなる ように、前記計時された休止時間に基づいて各パルスに 対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしてお り、第15の発明においては、レーザ光を所定回数連続 してパルス発振させた後、所定時間パルス発振を休止さ せる運転を繰り返し行い、前記パルスのエネルギーが所 定の大きさとなるように、レーザチャンパ内のレーザガ

スを励起させる放電電圧を制御するエキシマレーザ装置の制御装置において、前記レーザチャンパ内のレーザガスに含まれる不純物濃度を検出する手段を有し、前記検出されたレーザガスに含まれる不純物の濃度に基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにしており、第16の発明においては、前記第15の発明に記載のレーザガスに含まれる不純物がフッ化水素(HF)であり、第17の発明においては、前記第1から第16までの発明の制御方法の任意の組み合わせによって、各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させ 10 るようにしている。

[0012]

【作用】上記構成によれば、バーストモードで運転されるエキシマレーザ装置において、パワーロック電圧等スパイキング現象に寄与するパラメータを求め、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーが同一の大きさとなるように、上記パラメータに基づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させるようにした。そのため、パルスエネルギーのパラツキが低減され、露光量制御の精度が向上する。

[0013]

【実施例】前述のごとく、パーストモードでエキシマレーザを運転する場合、連続パルス発振の開始直後において、パルスエネルギーが大きくなる(以後、徐々にエネルギーが小さくなる)スパイキング現象が現れる。このスパイキング現象は、エキシマレーザ装置における種々のパラメータの影響によることが本発明者の実験により明らかになった。それらパラメータを用いてスパイキングの発生を防止する出力制御装置が本発明者によって提案されている。以下に、本発明に係るエキシマレーザ装 30 置の出力制御装置について、図面を参照して詳述する。

【0014】図1は本装置の全体構成を示すプロック図であり、大きくは出力レーザ光しを出力するエキシマレーザ装置1と、エキシマレーザ装置1を光源とし、出力レーザ光しにより縮小投影露光を行うステッパ9とから構成されている。

【0015】エキシマレーザ装置1の発振器2は、レーザチャンバ15、光共振器等からなり、レーザチャンバ15内にはKr、F2等からなるレーザガスが満たされている。そして、レーザチャンバ15内に配設された電 40極12a、12b間で放電を行い、レーザガスを励起させてレーザ発振を行う。発振されたレーザ光は上配光共振器内で共振され、図示しないフロントミラーから有効な出力レーザ光しとして出力される。なお、パルス放電は所定の時間間隔で行われ、出力レーザ光しが断続的に出力される。こうして発振器2から発振された出力レーザ光しは、ビームスプリッタ3によって一部サンプリングされ、レンズ4を介して出力モニタ5に入射される。この出力モニタ5では出力レーザ光しの1パルス当たりのエネルギー。すなわたパルスエネルギーFが輸出されるのエネルギーを対象によって、

る。

【0016】出力モニタ5によって検出されたパルスエネルギーEは、出力制御部6に加えられ、該出力制御部6は入力されたパルスエネルギーEに基づいて、後述するように所望のパルスエネルギーEdが得られるようにレーザ電源8に電圧データを加える。この場合、パワーロック制御が行われる。

10

【0017】パワーロック制御とは、レーザガスが劣化し、同じ放電電圧を与えてもパルスエネルギーEが低下してしまうことを、劣化に応じて放電電圧を高くすることで防止する制御方法の一つである。一般的には、発振された複数のパルスのエネルギーを積算、平均化し、所望のエネルギーEdと比較することによって、つぎのパルス以降の放電電圧を決定するフィードバック制御である。決定された放電電圧(Edを得るための放電電圧)をパワーロック電圧Vplと呼ぶ。なお、「POWERLOK」は米国Questek社の登録商標である。

【0018】これに対して、本発明によるスパイキング発生防止制御は、つぎに発振される1パルスのパルスエネルギーを予測して、放電電圧を発振前に決定する予測制御である。

【0019】レーザ電源部8は、加えられた電圧データに応じて上記電極間に電位差Vを与え、上記放電を行う。ここに、放電させるための電圧は、レーザ電源部8内に配設された充電回路17により一旦充電され、たとえばサイラトロン等のスイッチ素子の動作により放電される。この充電回路17は交換自在のユニットとして配設されている。

【0020】出力制御部6は、ステッパ9内のステッパ制御部10と信号線で接続されており、ステッパ制御部10から送出されるトリガ信号Trを受信する。出力制御部6はタイマを内蔵しており、このタイマによって送出されてくるトリガ信号Trの受信時刻間の時間が逐次測定される。

【0021】ガス制御部7は、レーザ出力を一定に保持すべくレーザ装置運転中にレーザガスの部分的ガス交換を行うとともに、レーザ装置運転前に所定の種類のレーザガスがそれぞれ所定の分圧となるようにガス交換を行うものであり、バルブ等を介してレーザチャンパ15内に供給されるレーザガスの供給量を制御するとともに、レーザチャンパ15から真空ポンプ等を介して排出されるレーザガスの排出量を制御する。このガス制御部7と出力制御部6との間では所定のデータの授受が行われ、ガス交換時のレーザガスの種類と各種類のガスの分圧を示す信号がガス制御部7から出力制御部6に送出される。

ザ光しは、ビームスプリッタ3によって一部サンプリン 【0022】レーザチャンバ15内の上側の放電電極1 グされ、レンズ4を介して出力モニタ5に入射される。 2aの表面には、この電極12aの表面温度Theを検 この出力モニタ5では出力レーザ光しの1パルス当たり 出する電極温度センサ13が配設されており、また、レ のエネルギー、すなわちパルスエネルギーEが検出され 50 ーザチャンバ15内にはレーザガスの温度Thmを検出

するガス温度センサ14が配設されている。これら各セ ンサ13、14で検出された温度The、Thmを示す 検出信号は、出力制御部6に送出される。なお、電極温 度センサ13は下側の電極12bあるいは両方に配設す るようにしてもよい。

【0023】レーザチャンパ15の両端にはそれぞれレ ーザ光を外部に出射するためのウインド16が配設され ているが、これら各ウインド16は反応生成物付着によ る出力劣化をウインド自体の交換によって除去すべく、 交換自在にレーザチャンパ15に配設されている。そし *10* て、上記レーザチャンパ15、レーザ電源部8を中心と して構成されるレーザヘッド18も、構成部品劣化によ る性能劣化を除去すべく交換自在に配設されている。レ ーザヘッド18を構成する部品の内、放電電極12a、 12 bの磨耗による劣化が特に著しい。したがって、レ ーザヘッド18の交換は、主として放電電極12a、1 2 b の性能維持を目的として行われる。

【0024】また、レーザチャンバ15内にはHFセン サ19(たとえばFTIRなど)を配設し、レーザガス 中に含まれるHF濃度をモニタするように構成してい 20 ーザガスを封入してからの経過時間Tgの考慮 る。HFセンサ19で検出されたHF濃度は、出力制御 部6に送出される。

【0025】外部制御装置11はエキシマレーザ装置1 外にあり、後述するようにスパイキング防止制御を停止 させるための解除信号を出力制御部6に送出する。

【0026】本実施例では、つぎに掲げる各パラメータ を考慮して連続パルスの各パルスに対応する放電電圧V を求めるようにしている。

(a)パルス発振の休止時間Tppの考慮

パーストモードでエキシマレーザを運転する場合、連続 30 パルス発振の開始直後においてパルスエネルギーEが大 きくなる(以後、徐々にエネルギーが小さくなる)スパ イキング現象が現れる(図3参照)。このスパイキング 現象はパーストモードにおける発振休止時間Tppが大 きくなるほど顕著になることが本発明者等の実験によっ て明らかになっている。また、パルスエネルギーEは、 レーザガスを励起させるための放電電圧Vを大きくする にしたがって大きくなるという性質がある。

【0027】そこで、パルス発振の休止時間Tppを計 時し、つぎの連続パルスの各パルスのエネルギーEが同 40 一の所望の大きさEdとなるように、計時された休止時 間Tppに基づいて各パルスに対応する放電電圧Vの大 きさを変化させる。すなわち、連続パルス発振の最初の パルスは放電電圧Vを低くし、以後徐々に放電電圧Vを 高くするごとく、放電電圧を各パルスごとに変化させて スパイキング現象による初期のエネルギー上昇を防止す る。しかも、休止時間Tppに応じて放電電圧Vの変化 度合いを異ならせるようにする。この結果、常に各パル スのエネルギーレベルが同一な値Edになる。

【0028】 (b) パワーロック電圧Vplの考慮

レーザ発振の運転時間が長くなり、レーザガスが劣化し てくるに応じてパルスエネルギーEが低下してしまい、 これを防止するために劣化に応じてパワーロック電圧V plを大きくするパワーロック制御が行われる。しか し、パワーロック制御が行われるとスパイキング現象の 発生パターンが変化してしまうことが本発明者等の実験 によって明らかになった。すなわち、パワーロック電圧 Vplの大きさに応じてパルスエネルギーEが変化する とともに、スパイキング現象の影響が及ぶパルスの数が 変化すること等が明らかになった。そこで、パワーロッ ク電圧Vp1に応じてパルスエネルギーEが所望の大き さEdになるように放電電圧Vを変化させる必要があ る。

12

【0029】そして、同様にして以下の各パラメータの 値によってもスパイキング現象の発生パターンが変化す ることが明らかになっている。したがって各パルスのエ ネルギーレベルを同一にするには下記(c)~(n)の パラメータをも考慮する必要がある。

- (c)ガス交換によりレーザラャンパ15内に新しいレ
- (d)ガス交換によりレーザチャンパ15内に新しいレ ーザガスを封入してからの累積発振パルス数Ngの考慮
- (e)ガス交換時にレーザチャンバ15内に封入された レーザガスの種類とレーザガスの種類ごとの分圧の考 慮;たとえば、希ガス(Kr)、ハロゲンガス(F)、 パッファガス(Ne)で構成されるレーザガスの各分圧 Pr、Ph、Pbの考慮
- (f) レーザガスの温度Thmの考慮
- (g)放電電極12aの温度Theの考慮
- (h)連続パルス発振の繰り返し周波数 f の考慮
- (1) エキシマレーザ装置1の運転開始からの経過時間 Ttの考慮
- (亅)パルス発振間隔Tdの考慮
- (k) レーザヘッド18が交換されてからの累積発振パ ルス数Nhの考慮
- (1) 充電回路17が交換されてからの累積発振パルス 数Ncの考慮
- (m)レーザウインド16が交換されてからの累積発振 パルス数Nwの考慮
- (n)レーザガス中に含まれる不純物の濃度、特にHF 濃度の考慮

【0030】以下、出力制御部6で行われる処理につい て、図2および図3に示すフローチャートを参照して説 明する。まず、図2(a)に示すように、起動と同時に メインルーチン内において、各部の初期設定が行われ (ステップ101)、発振開始が可能であることを指示 するべく割り込み受付状態にする(ステップ102)。 出力制御部6が割り込み受付状態になると同時に、内蔵 の発振休止時間計時用のタイマによる割り込みを受け付

50 けるべく図2(b)に示すタイマ割込ルーチンに移行さ

れ、前回トリガ信号Tェが受信されてから次回にトリガ 信号Trを受信するまでの間、タイマを順次カウントア ップさせ、カウント数nを順次+1インクリメントして いく(ステップ103)。

【0031】次回のトリガ信号Trが受信されると、図 3 (c) に示すトリガ割込ルーチンに移行され、タイマ 割り込みのカウントアップをやめて、その時点のカウン ト数nを時間に換算する処理を行い、換算された時間を 発振休止時間Tpp(図4参照)とする。たとえば、タ イマ割り込みのインターパルが10msec であり、カウ 10 ント数nが15であれば両者を乗算することにより休止 時間Tppが150msec とされる(ステップ104)。 なお、時間に換算された時点でタイマのカウント数nは 零にリセットされる。出力制御部6はまた、トリガ信号 Trが所定時間よりも小さい間隔で受信されさるごとに カウントアップされるトリガカウンタを有しており、こ のトリガカウンタのカウント数によってトリガ信号Tr が受信された直後に発振されるパルスが連続パルス発振 の何番目のパルスであるがが認識される。

夕に関するデータが取得される。一方において、下記 (1) 式に示すように、発振順序 i のパルスに対応する 放電電圧V(i)が、上記各パラメータTpp、Vpl ・・・・を変数とする関数Vi(Tpp、Vp1・・・)とし てあらかじめ実験によって求められており、メモリに記 **憶されている。したがって、各パラメータTpp、Vp** 1·・・ が得られれば、これらを関数Vi()に代入する ことにより、対応する放電電圧を求めることができる。

 $[0\ 0\ 3\ 3]\ V\ (i) = V\ i\ (Tpp, Vpl, Tg, Ng, Pr, Ph, P$ b, Thm, The, f, Tt, Td, Nh, Nc, Nw, Chf) · · · (1) ただし、V(i):連続パルス発振のi番目のパルスの 放電電圧

Vi :連続パルス発振のi番目のパルスの放電電圧 を決定する関係式

Tpp : 発振休止時間

Vp1 :パワーロック電圧

Τg :ガス交換によりレーザチャンパ15内に新し いレーザガスを封入してからの経過時間

Ng :ガス交換によりレーザチャンパ15内に新し いレーザガスを封入してからの累積発振パルス数

:ガス交換時にレーザチャンパ15内に封入さ Pr れたレーザガスの内の希ガス(Kr)の分圧

Ph :ガス交換時にレーザチャンバ15内に封入さ れたレーザガスの内のハロゲンガス(F2)の分圧

Рb :ガス交換時にレーザチャンバ15内に封入さ れたレーザガスの内のパッファガス(Ne等)の分圧

Thm:レーザガスの温度

The :放電電極12の温度

f :連続パルス発振の繰り返し周波数

Tt :レーザ装置の運転開始からの経過時間 Τd :パルス発振間隔

: レーザヘッド18が交換されてからの累積発 Nh 振パルス数

14

:充電回路17が交換されてからの累積発振パ Nc ルス数

:レーザウインド16が交換されてからの累積 Nw発振パルス数

Chf:HF濃度

【0034】発振休止時間Tppは上記ステップ104 において演算によって求められる。パワーロック電圧V p l は、パワーロック制御時における電圧として取得さ れる。経過時間Tgは、ガス制御部7によってレーザ運 転開始前におけるガス交換がなされてからの経過時間が 所定のタイマにより計時されており、現在のタイマの計 時値を読み出すことにより取得される。累積発振パルス 数Ngも、ガス交換時からのパルス数が所定のカウンタ によりカウントされており、カウンタのカウント値を説 み出すことにより取得される。

【0035】分圧Pェ、Ph、Pbは、ガス交換時にそ 【0032】ついで、上記(a)~(n)の各パラメー 20 れぞれの値がガス制御部7で検出されており、この交換 時の値をつぎの交換時まで用いる。なお、このように交 換時の分圧をつぎの交換時まで使用しているのは、一般 にレーザガスの組成および成分ガスの分圧はレーザ運転 中に大きく変化することはなく、各時点の分圧を検出し なくても所定の精度が得られるからである。したがっ て、出力制御部6のメモリ内に種々のガス組成および成 分ガスの分圧の組み合わせに対応した計算式を記憶して おき、レーザガス交換時に、検出されたレーザカスの組 成および成分ガスの分圧に対応した計算式をメモリから 読み出し、つぎのガス交換まで同じ計算式を用いること ができる。このため、レーザ運転中に読み出された計算 式に残りのパラメータを代入して計算することができ、 計算の煩雑さが解消される。なお、分圧以外の他のパラ メータであっても、レーザ運転中、つぎのガス交換時ま でに値が大きく変化しないものがあれば、同様の手法を 適用することができ、、演算時間の短縮を図ることがで きる。

> 【0036】レーザガスの温度Thmはガス温度センサ 14の出力として取得され、放電電極12の温度The 40 は電極温度センサ13の出力として取得される。繰り返 し周波数 f はレーザ発振中のトリガ信号Tェの受信間隔 に基づき取得される。レーザ装置の運転開始からの経過 時間Ttは、レーザ装置の運転開始に伴いスタートする タイマの計時値として取得され、パルス発振間隔Tdも トリガ信号Trの受信間隔に基づき取得される。累積発 振パルス数Nh、Nc、Nwは、各ユニットが交換され てからの時間をそれぞれ所定のタイマにより計時してお くことにより得られる。 HF濃度はレーザチャンパ1 5内に配設されたHFセンサ19によって検出される

50 (ステップ105)。

【0037】このようにして、各パラメータのデータが 取得されると、各取得データに対応する最初のパルス (i=1)における放電電圧V1が演算され(ステップ 106)、これがレーザ電源部8に出力され次の連続パ ルス発振の最初のパルスにおける放電が行われる(ステ ップ107)。この結果、連続パルス発振の最初のパル スにおいてスパイキング現象の影響が除去され、所望の パルスエネルギーE d が得られる。 つぎにトリガカウン タのカウント数に応じて発振順序iをインクリメント し、各取得データに対応する放電電圧Viが順次演算さ れ(ステップ106)、これがレーザ電源部8に出力さ れることにより放電が順次行われる (ステップ10 7)。この結果、連続パルス発振の各1番目のパルスに おいて順次スパイキング現象が除去され、すべてのパル

スのエネルギーが一定エネルギーEdとなる。

【0038】ところで、レーザ装置1のレーザ出力の調 整時等で、上記スパイキング発生防止制御が逆に障害に なる場合がある。この場合、外部制御装置11からスパ イキング発生防止制御解除信号が出力制御部6に対し送 出される。すなわち、図3 (d) に示すスパイキング発 20 生防止制御解除信号割り込みルーチンの割り込みがかか り、上記解除信号を受信し(ステップ108)、スパイ キング発生防止制御解除フラグがたてられる(ステップ) 109)。このフラグが立てられている間は、スパイキ ング発生防止制御は中止されることになる。このとき、 スパイキング発生防止制御解除信号の発生は外部制御装 置11に図示しないスイッチを付設してオペレータが入 力しても良いし、また、出力モニタ5から出力に不備が ある信号を受けて出力制御部6が自己判断しても良い。 また、ステッパ制御部10にスイッチを設けて出力制御 30 部6からの信号によりスパイキング発生防止の解除を行 っても良い。

【0039】本実施例では(a)~(n)に示す各パラ メータに基づき放電電圧を演算するようにしているが、 これは一例に過ぎず、このうち任意の1つのパラメータ のみに基づき放電電圧を演算してもよく、また任意の2 以上のパラメータに基づき放電電圧を演算してもよい。

【0040】また、本実施例では、不純物センサとして HFセンサのみをレーザチャンバ15内に配設している が、この他の不純物、たとえば、N2、CO、OF2、 40 11 外部制御装置 CF4, SiF4, COF2, CO2, NO2F, SF 6、NOF、CrO2F2、CC13F、H2O等のセ ンサも共に配設すればさらにスパイキング発生防止制御 精度が向上する。また、本実施例ではHFセンサに代表 される不純物センサをレーザチャンパ内に配設している が、これらセンサをレーザチャンバ15から突出して設 けられた、チャンパ内のレーザガスが行き来可能な不純 物センサポート等や、レーザガスをチャンパから取り出 し再度チャンパに戻すような循環経路等に配設してもよ

V1°

【0041】本実施例では、KFFエキシマレーザを例 に説明しているため、KrFエキシマレーザ特有の不純 物をモニタしている。したがって、XeC1、ArF、 XeF、F2、KrClエキシマレーザ等の場合は、こ れらに用いられるレーザガス特有の不純物をモニタすれ ばよい。

16

[0042]

【発明の効果】以上詳述したごとく、本発明によれば、 パーストモードで運転されるエキシマレーザ装置におい て、パワーロック電圧等スパイキング現象に寄与するパ ラメータを求め、つぎの連続パルスの各パルスのエネル ギーが同一の大きさとなるように、上記パラメータに基 づいて各パルスに対応する放電電圧の大きさを変化させ るようにしたため、スパイキング現象が除去され、各パ ルスのエネルギーを同一にすることができ、たとえパル ス数の少ない連続パルス発振であっても露光量制御の精 度を飛躍的に向上することのできるエキシマレーザ装置 の出力制御装置が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のエキシマレーザ装置の出力制御装置の 構成を示すプロック図である。

【図2】本発明の実施例の第1の処理手順を示すフロー チャートである。

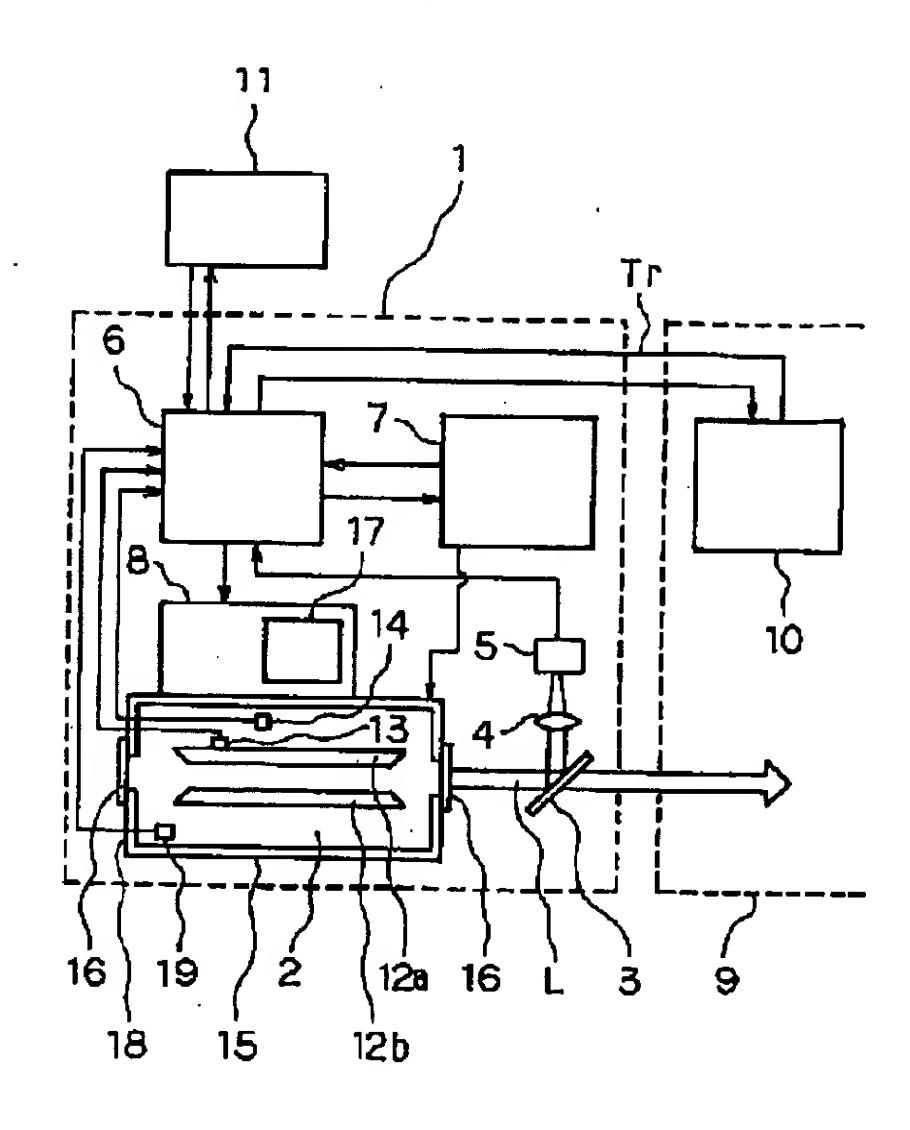
【図3】本発明の実施例の第2の処理手順を示すフロー チャートである。

【図4】パーストモードエキシマレーザのスパイキング 現象を説明するためのグラフである。

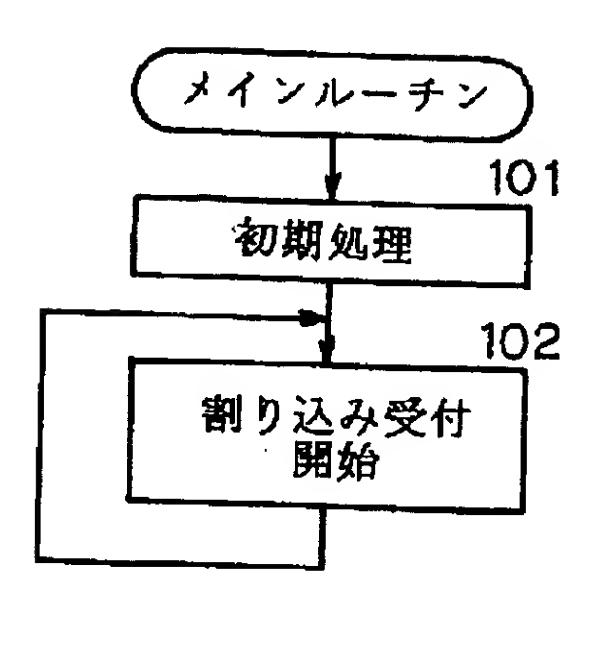
【符号の説明】

- 1 エキシマレーザ装置
 - 発振器
 - 3 ピームスプリッタ
 - 4 レンズ
 - 5 出力モニタ
 - 6 出力制御部
 - ガス制御部
 - 8 レーザ電源部
 - 9 ステッパ
 - 10 ステッパ制御部
 - - 12a, 12b 放電電極
 - 13 電極温度センサ
 - 14 ガス温度センサ
 - 15 レーザチャンパ
 - 16 ウインド
 - 17 充電回路
 - 18 レーザヘッド
 - 19 HFセンサ

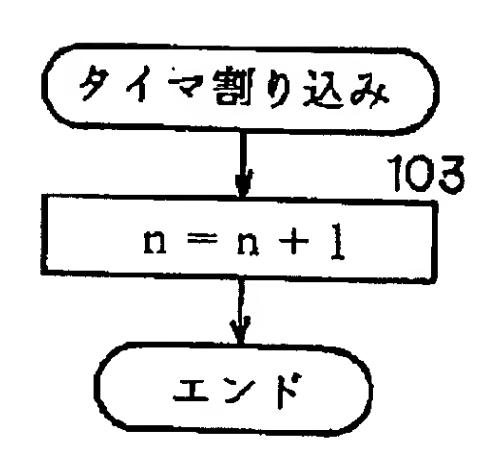
【図1】



【図2】



(g)

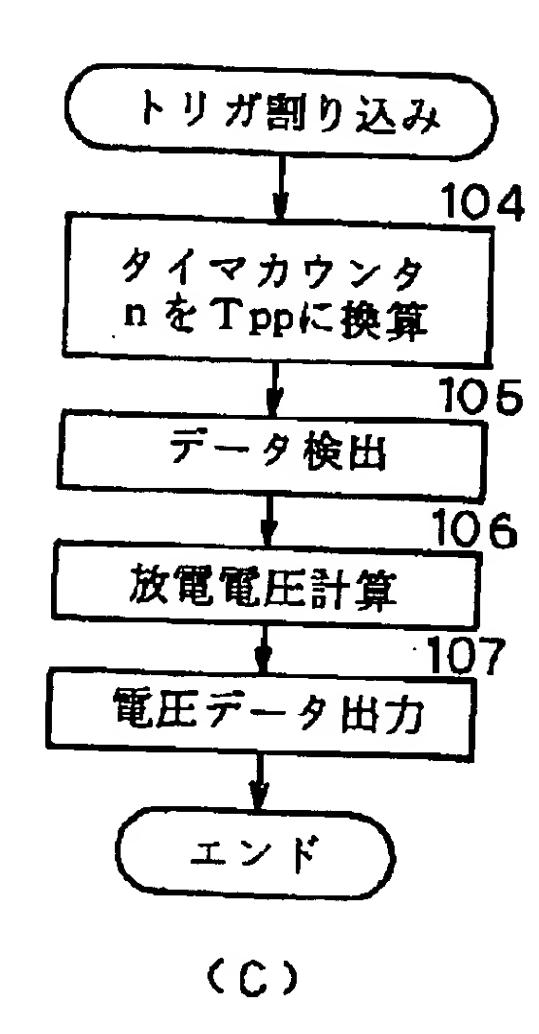


n:タイマ割り込み発生 回数カウンタ

(b)



 $(\Phi_{\mathcal{F}}) = \Phi_{\mathcal{F}} = \phi_{\mathcal{F}}$



【図4】

